

大見研究室 和文 論文リスト

2000 年

- 919(M) 大見忠弘、「東北大学未来科学技術共同研究センター」、学術月報、(日本学術振興会)、Vol.53、No.1、通巻 662 号、pp.39-40、2000 年 1 月。
- 920(M) 大見忠弘、「超高速、低コストのシステムLSIを作る」、日経NE2000 年 1 月 31 日号、(日経BP社)、No.762、pp.163-170、2000 年 1 月。
- 921(M) 大見忠弘、「産官学連携 ベンチャービジネスの創出」、通産情報、(通商産業省 東北通商産業局)、Vol.42、No.11、pp.4-10、2000 年 2 月。
- 922(P) 大見忠弘、「0.1 μ m 以降のプロセス技術課題」、ISS Japan2000(SEMIジャパン)、2000 年 2 月。
- 923(M) 大見忠弘、「巻頭言 革命期を迎える半導体産業」、半導体シニア協会ニューズレター、(SSIS半導体シニア協会)、No.12、pp.1-3、2000 年 3 月。
- 924(P) 大見忠弘、須川成利、平山昌樹、「低エネルギーイオン照射低温シリコン成膜技術」、第 47 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集No.0、((社)応用物理学会)、28p-YM-5、pp.17、2000 年 3 月。
- 925(P) 大見忠弘、「新たなミレニアムに向けて」、第 34 回ウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムプロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.別刷(New Paradigm in Semiconductor Industry)、2000 年 3 月。
- 926(B) 大見忠弘、「第 1 章 序論 システムLSI時代の主役:SOI LSI」、SOIの科学、半導体基盤技術研究会編、(リアライズ社)、pp.3-4、2000 年 4 月。
- 927(B) 大見忠弘、「第 3 章 デバイス・プロセス技術 第 11 章 気体分離配線構造・金属基板SOIデバイス技術」、SOIの科学、半導体基盤技術研究会編、(リアライズ社)、pp.194-205、2000 年 4 月。
- 928(C) 東北大:篠原壽邦、平間淳司、高橋一郎、平山昌樹、白井泰雪、大見忠弘、コマツ:武久究、伊藤貴志、西坂敏博、藤本准一、溝口計、「連続発光エキシマレーザの検討(A research of realizing CW excimer laser)」、第 47 回応用物理学関係連合講演会、講演予稿集 29-p-F-3、第 700 頁、2000 年春季
- 929-1(M) 大見忠弘、須川成利、「家庭内ネットワークの鍵を握るLSI高性能化」、実践技術ジャーナル、(ミマツコーポレーション)、No.1、pp.45-58、2000 年 5 月。
- 930(B) 大見忠弘、「第 1 章 序論 半導体固有の製造技術創出:半導体技術はまさにこれから」、新しい半導体製造プロセスと材料、(株)シーエムシー)、pp.1-16、2000 年 5 月。
- 931(B) 大見忠弘、横井生憲、グン・ミン・チョイ、「第 6 章 洗浄 1 低環境負荷シリコン基板洗浄技術」、新しい半導体製造プロセスと材料、(株)シーエムシー)、pp.142-151、2000 年 5 月。
- 932(M) 大見忠弘、須川成利、平山昌樹、白井泰雪、「製造技術に学問の導入を提言 21 世紀を見すえた新デバイス・新生産方式を提案」、日経マイクロデバイス6月1日号、No.180、(日経BP)、pp.177-182、2000 年 6 月。
- 933(F) 大見忠弘、横井生憲、森田博志、伊井稔博、グン・ミン・チョイ、白井泰雪、「オゾンの半導体製造分野への適用」、静電気学会誌、Vol.24、No.3、(静電気学会)、pp.16-20、2000 年 6 月。
- 934(P) 大見忠弘、「第 3 部 半導体技術の研究開発課題 1.半導体技術開発の戦略的取り組み」、21 世紀を開く半導体技術ワークショップ~IT社会を支えるキーテクノロジー・シリコンLSI技術の課題と将来展望~、(通商産業省、NEDO)、pp.3-3-3-10、2000 年 6 月。
- 935(P) 大見忠弘、「第 3 部 半導体技術の研究開発課題 4.主要半導体技術領域におけるディスカッション (Part2)(2)生産技術パネルディスカッション」、21 世紀を開く半導体技術ワークショップ~IT社会を支えるキーテクノロジー・シリコンLSI技術の課題と将来展望~、(通商産業省、NEDO)、pp.3-81-3-93、2000 年 6 月。

- 929-2(P) 大見忠弘、須川成利、「半導体産業復活のシナリオ」、第 18 回大阪酸素 半導体セミナーグローバルネットワーク時代の半導体産業一、(大阪酸素工業株)、pp.69-80、2000 年 6 月。
- 936(M) 大見忠弘、菅田正宏、中山貴裕、家村広継、「新ベクトル量子化による画像圧縮技術の開発」、コンピュータサイエンス誌 Bit、(共立出版)、7 月号、pp.29-36、2000 年 6 月。
- 937(P) 大見忠弘、須川成利、平山昌樹、斉藤祐司、田中宏明、「金属汚染・表面損傷を伴わない高密度プラズマを用いた低温高品質成膜技術」、第 17 回薄膜スクール資料、(日本学術振興会)、pp.105-111、2000 年 7 月。
- 938(P) 大見忠弘、「UCS12年を語る／未来への飛躍に向けて」、第 29 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーワークショップ—半導体産業復活のシナリオ:高収益型小規模生産ラインの実現プロシーディング、(UCS半導体基盤技術研究会)、pp.1-30、2000 年 7 月。
- 939(M) 大見忠弘、須川成利、平山昌樹、「連載[マニファクチャリング] 製造技術に学問の導入を提言(1) システムLSI、ディスプレイ、太陽電池デバイス技術を塗り替える」、日経マイクロデバイス 8 月 1 日号、No.182、(日経BP社)、pp.213-220、2000 年 8 月。
- 940(F) 末永修、松尾剛伸、森直樹、小林貞雄、大見忠弘、「半導体工場における省エネルギー技術の提案」、クリーンテクノロジー、Vol.10、No.8、(日本工業出版)、pp5-9、2000 年 8 月。
- 941(F) 大見忠弘、横井生憲、阿部俊和、「半導体産業における超純水製造技術とその特性」、防錆管理、Vol.44、No.9、(社)日本防錆技術協会)、pp.13-20、2000 年 9 月。
- 942(M) 大見忠弘、須川成利、平山昌樹、「連載[マニファクチャリング] 製造技術に学問の導入を提言(2) 小規模生産ラインを可能にする装置技術、8 項目を提案」、日経マイクロデバイス 9 月 1 日号、No.183、(日経BP社)、pp.186-189、2000 年 9 月。
- 943(P) 大見忠弘、須川成利、斉藤祐司、田中宏明、「高性能ポリシリコントランジスタの低温製造技術」、第 61 回応用物理学学会学術講演会予稿集、No.O、((社)応用物理学学会)、pp.53、2000 年 9 月。
- 944(P) 大見忠弘、「情報通信と半導体の融合化を推進するグローバルネットワーク時代」、平成 12 年電気・情報関連学会連合大会講演予稿集、pp.42-51、2000 年 9 月。
- 945(F) 大見忠弘、須川成利、「マイクロ波励起低温高密度プラズマプロセス」、真空、Vol.43、No.9、(日本真空協会)、pp.31-38、2000 年 9 月。
- 946(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーのフィロソフィー、その展望と課題」、UCSクロージングシンポジウム「半導体が拓く新世紀に向けて」プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.16-54、2000 年 9 月。
- 947(P) 鈴木宏和、大見忠弘、白井泰雪、花岡秀夫、「クリーンルームを有する施設の省エネルギー化に関する研究 その1 シミュレーションプログラム開発と適用」、平成12年度学術講演会講演論文集、((社)空気調和・衛生工学会)、pp.1481-1484、2000 年 9 月。
- 948(M) 大見忠弘、須川成利、平山昌樹、白井泰雪、「連載[マニファクチャリング] 製造技術に学問の導入を提言(3) 強誘電体、高誘電率膜を徹底利用へ LSIの付加価値高める基盤技術」、日経マイクロデバイス10月1日号、No.184、(日経BP社)、pp.170-173、2000 年 10 月。
- 949(F) 大見忠弘、須川成利、平山昌樹、斉藤祐司、「マイクロ波励起Kr/O₂によるシリコン酸化膜の低温形成」、応用物理、Vol.69、No.10、(応用物理学学会)、1200-1204、2000 年 10 月。
- 950(M) 大見忠弘、「LCD生産工程におけるクリーン化技術」、月刊ディスプレイ、11 月号、(株)テクノタイムズ(社)、pp1-6、2000 年 11 月。
- 951(M) 大見忠弘、大見忠弘教授が提唱する「日本半導体の新たな挑戦」／未来への飛躍に向けて—半導体生産技術に学問を—「今、半導体王国の復活に求められる技術はこれだ!」、(半導体産業新聞フォーラム 21)、2000 年 11 月。
- 952-1(M) 島田浩行、大嶋一郎、中尾慎一、中川宗克、須川成利、大見忠弘、「低温プロセスを特徴とする低抵抗 TaNx/Ta/TaNx メタルゲートFDSOI-CMOS技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.340、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM2000-158~186、pp.23-30、2000 年 11 月。

- 952-2(P) Zhibin Pan、Koji Kotani、Tadahiro Ohmi、「A VQ-based speaker identification system for large population using exponential average and pre-learning of test utterance」、第4回システムLSI琵琶湖ワークショップ「システムLSI及びその要素技術の研究開発事例」ポスターセッション発表リスト、pp.239-242、2000年11月27日～29日。
- 953(W) 川添豪哉、青木英治、藤井克正、大見忠弘、「0.18 μ m CMOS プロセスに適合した LSI の静電気保護技術」、第 11 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.35-41、2000年11月。
- 954(W) 三森健一、芳賀宣明、高橋典久、今岡孝之、大見忠弘、「大型・高精度 TFT・LCD デバイスの洗浄技術」、第 11 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.43-46、2000年11月。
- 955(W) 泉浩人、菊永芳弘、川脇理謁、菊山裕久、櫻井稔久、大見忠弘、「フッ素ガスを用いた金属表面処理技術とその応用」、第 11 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.47-52、2000年11月。
- 956(W) 高野順、斉藤祐司、櫻井稔久、大見忠弘、「低温酸化、低温アニールプロセスを実現する Kr/O₂ プラズマ技術」、第 11 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.53-61、2000年11月。
- 957(W) 阿久津功、平山昌樹、大見忠弘、「高効率半導体生産ラインを実現する高性能ブースターポンプの開発」、第 11 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.81-88、2000年11月。
- 958(W) 大見 忠弘、「顧客ニーズ瞬時製品化技術」、第 11 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.89-110、2000年11月。
- 959(M) 大見忠弘、白井泰雪、「21 世紀における半導体産業の展望」、セミコンダクターアニュアル／ガス供給編 2000、(ガスメディア) pp.14-19、2000年。